

HIGH ACCURACY RTD WAFER

THERMOWAY RTD WAFER 專為需要高精度溫度測量的製程所設計，例如半導體光阻劑處理系統、晶圓探測器和許多其他類型的半導體製造設備。

透過研發團隊精心整合設計帶來高量測精度和結果穩定性，WAFER 上的 RTD 傳感器，黏合及封裝材料，四線式電阻測量方式是關鍵的集成元件。



Features

- 工作溫度範圍： -80°C to 300°C
- 溫度點位： 1 to 160 points
- 提供校正服務
- 提供應用軟體及分析系統

Applications

- 測量和記錄製程週期的晶圓溫度：裝載、升溫、穩定狀態、冷卻和卸載。
- 提升對溫度的控制及一致性。
- 管理具有嚴格熱性能規格的生產流程或為 SPC 系統提供數據。
- 在硬體或製程研發期間優化晶圓工藝。
- 在最終鑑定、晶圓廠啟動以及修復或升級系統的重新鑑定過程中對晶圓廠設備進行測試和基準測試。

Specifications

Temperature Range:	-80°C to 300°C
Wafer Size:	6", 8", 12"
Element Type:	Thin Film Platinum
Element Resistance:	100Ω, 1000 Ω nominal at 0°C
Resistance Alpha Value:	0.00385
Max. Measurement Current:	200 μA
Accuracy with Calibration Correction:	±0.1°C absolute accuracy, ±0.03°C sensor to sensor accuracy Also available in customized high accuracy ±0.05°C @ 0°C
Resolution:	0.01°C
Type of Connection:	3-Wire or 4-wire resistance measurement with common current source return
Lead Materials:	Polyimide coated copper
Cable Construction:	Polyimide film flat cable section transitioning to a silicon rubber round flex cable.
Connection:	D-type, high density, sub-miniature with 68 pins.